

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/037778 A1

(51) 国際特許分類: C07C 381/12
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014604
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 4 日 (04.10.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2003-360774
2003 年 10 月 21 日 (21.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 和光純
薬工業株式会社 (WAKO PURE CHEMICAL INDUS-
TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5408605 大阪府大阪市中央区
道修町三丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 角野 元重 (SUM-
INO, Motoshige) [JP/JP]; 〒3501101 埼玉県川越市大
字的場 1 6 3 3 Saitama (JP). 深沢 和仁 (FUKASAWA,
Kazuhito) [JP/JP]; 〒3501101 埼玉県川越市大字的場

1 6 3 3 Saitama (JP). 今関 重明 (IMAZEKI, Shigeaki)
[JP/JP]; 〒3501101 埼玉県川越市大字的場 1 6 3 3
Saitama (JP). 渡辺 哲也 (WATANABE, Tetsuya) [JP/JP];
〒3501101 埼玉県川越市大字的場 1 6 3 3 Saitama
(JP).

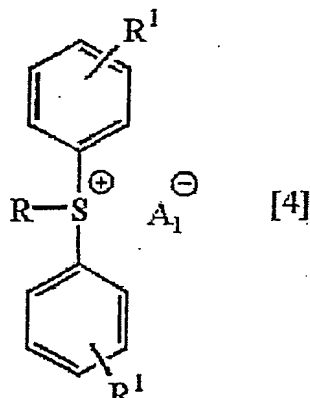
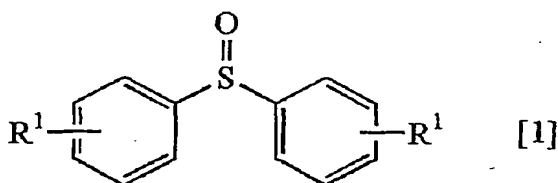
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING TRIARYLSULFONIUM SALT

(54) 発明の名称: トリアリールスルホニウム塩の製造法



(57) Abstract: A process by which a triarylsulfonium salt in which only one aromatic ring differs from the others can be efficiently produced. The process, which is for producing a triarylsulfonium salt represented by the general formula [4]: (wherein R represents aryl optionally having a substituent different from R¹; and A₁ represents a strong-acid residue), is characterized by reacting a diaryl sulfoxide represented by the general formula [1]: with an aryl-Grignard reagent represented by the general formula [2]: RMgX (wherein X represents halogeno) in the presence of an activator having a high affinity for oxygen, the activator being used in an amount of 3 to 7.5 equivalents to the diaryl sulfoxide, and then reacting the reaction product with either a strong acid represented by the general formula [3]: HA₁ or a salt of the acid.

[続葉有]



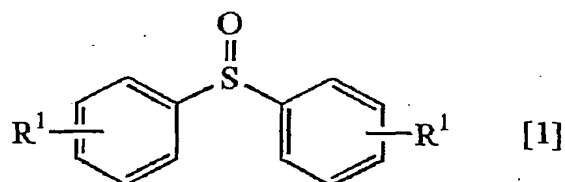
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類：
— 国際調査報告書

(57) 要約:

本発明は、1つの芳香環のみが異なるトリアリールスルホニウム塩を、効率よく製造し得る方法であり、一般式 [1]



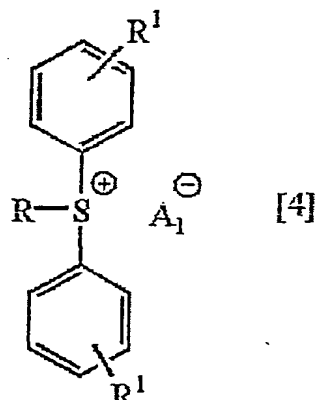
で示されるジアリールスルホキシドと一般式 [2]

RMgX [2]

(式中、Rは R^1 とは異なる置換基を有していてもよいアリール基を、Xはハロゲン原子を表す。) で示されるアリールグリニャール試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して3・7・5当量の、酸素に対して親和性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式 [3]

HA_1 [3]

(式中、 A_1 は強酸残基を表す。) で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式 [4]



で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法に関する。